

プラズマCVD装置 CP-1700



プラズマCVD装置CP-1700は縦型石英管の外周に置かれたコイルによって発生したプラズマ中を、ヒーターを内蔵した基板ホルダーを上下することができます。これによって、ダウンフローによるプラズマCVDの実験もできます。また基板には、DCバイアスをかけることができます。

プラズマCVD装置 CP-1700 仕様

○膜種	a-Si/Si ₃ N ₄
○炉体サイズ	φ90mm×500mm
○炉体材質	石英
○基板形状	3インチ 1枚
○到達圧力	×10 ⁻² Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 ⁻¹ Pa台迄3分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○加熱温度	500℃
○圧力コントロール	自動
○ガス種	SiH ₄ /NH ₃ /H ₂ /N ₂
○電源	RF電源 13.56MHz 500W 自動マッチング 1台 DC電源 1200V 1.2KW 1台
○真空排気系	油回転ポンプ:167L/min メカニカルブースターポンプ:30m ³ /h
○真空計	ピラニ真空計/バロトロン真空計
○ユーティリティ	電気:AC200V三相10kVA 冷却水:15L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上